

二氧化硅靶材SiO₂磁控溅射靶材

产品名称	二氧化硅靶材SiO ₂ 磁控溅射靶材
公司名称	北京晶迈中科材料技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:晶迈中科 型号:根据客户要求定制 产地:北京
公司地址	北京市通州区张家湾镇北大化村东(北京五木服装有限责任公司)2幢二层B2256 (注册地址)
联系电话	010-86208200 13301329625

产品详情

科研实验专用二氧化硅靶材SiO₂磁控溅射靶材电子束镀膜蒸发料

产品介绍

二氧化硅 (SiO₂) 常温下为固体, 不溶于水, 是酸性氧化物, 不跟一般酸反应, 但溶于氢氟酸及热浓磷酸, 能和熔融碱类起作用。自然界中存在有结晶二氧化硅和无定形二氧化硅两种。结晶二氧化硅因晶体结构不同, 分为石英、鳞石英和方石英三种。二氧化硅是制造玻璃、石英玻璃、水玻璃、光导纤维、电子工业的重要部件、光学仪器、工艺品和耐火材料的原料, 是科学研究的重要材料。

二氧化硅 (SiO₂) 溅射靶可用于半导体, 化学气相沉积 (CVD) 和物理气相沉积 (PVD) 显示器和光学应用。

二氧化硅 (SiO₂) 的其他形状溅射靶材: 圆盘, 平板, 柱子靶, 台阶靶, 定制

包装: 二氧化硅 (SiO₂) 溅射靶是真空密封的。

产品参数

中文名 二氧化硅 化学式 SiO₂ 熔点 1650 ± 50

分子量 60.084 密度 2.2 g/cm³ 沸点 2230

纯度 99.99%

支持靶材定制, 请提供靶材产品的元素、比例 (重量比或原子比)、规格, 我们会尽快为您报价!!!

服务项目：靶材成份比例、规格、纯度均可按需定制。科研单位货到付款，质量保证，售后无忧！

产品附件：发货时产品附带装箱单/质检单/产品为真空包装

适用仪器：多种型号磁控溅射、热蒸发、电子束蒸发设备

质量控制：严格控制生产工艺，采用辉光放电质谱法GDMS或ICP光谱法等多种检测手段，分析杂质元素含量保证材料的高纯度与细小晶粒度；可提供质检报告。

加工流程：熔炼 提纯 锻造 机加工 检测 包装出库

陶瓷化合物靶材本身质脆且导热性差，连续长时间溅射易发生靶裂情况，绑定背靶后，可提高化合物靶材的导热性能，提高靶材的使用寿命。我们强烈建议您，选购陶瓷化合物靶材一定要绑定铜背靶！

我公司采用高纯铜作为焊料，铜焊厚度约为0.2mm，高纯无氧铜作为背靶。

注意：高纯铜的熔点约为156℃，靶材工作温度超过熔点会导致铜熔化！绑定背靶不影响靶材的正常使用！

建议：陶瓷脆性靶材、烧结靶材，高功率下溅射易碎，建议溅射功率不超过3W/cm²。